

488696-2026 - Mise en concurrence

Irlande – Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement

Fournitures

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Education Procurement Service (EPS)

Adresse électronique: info@educationprocurementservice.ie

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Description: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identifiant de la procédure: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): South-East (IE052)

Pays: Irlande

2.1.3. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.5. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 4

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Description: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identifiant interne: 1

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): South-East (IE052)

Pays: Irlande

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: anglais

Langues dans lesquelles les documents de marché (ou des parties de ceux-ci) sont officieusement disponibles: anglais

Date limite de demande d'informations complémentaires: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Adresse des documents de marché: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: anglais

Catalogue électronique: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée

Date limite de réception des offres: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Lieu: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Pas encore connu

Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: The High Court of Ireland

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Education
Procurement Service (EPS)

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: The High Court
of Ireland

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Education Procurement
Service (EPS)

Organisation qui traite les offres: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Lot: LOT-0002

Titre: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Description: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identifiant interne: 2

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): South-East (IE052)

Pays: Irlande

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: anglais

Langues dans lesquelles les documents de marché (ou des parties de ceux-ci) sont officiellement disponibles: anglais

Date limite de demande d'informations complémentaires: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Adresse des documents de marché: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: anglais

Catalogue électronique: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée

Date limite de réception des offres: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Lieu: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Pas encore connu

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: The High Court of Ireland

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Education Procurement Service (EPS)

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: The High Court of Ireland

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Education Procurement Service (EPS)

Organisation qui traite les offres: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Lot: LOT-0003

Titre: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Description: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identifiant interne: 3

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): South-East (IE052)

Pays: Irlande

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: anglais

Langues dans lesquelles les documents de marché (ou des parties de ceux-ci) sont officieusement disponibles: anglais

Date limite de demande d'informations complémentaires: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Adresse des documents de marché: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: anglais

Catalogue électronique: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée

Date limite de réception des offres: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Lieu: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Pas encore connu

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: The High Court of Ireland

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Education Procurement Service (EPS)

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: The High Court of Ireland

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Education Procurement Service (EPS)

Organisation qui traite les offres: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Lot: LOT-0004

Titre: Plasma Deposition ,PECVD

Description: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identifiant interne: 4

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

5.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): South-East (IE052)

Pays: Irlande

5.1.3. Durée estimée

Durée: 48 Mois

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: anglais

Langues dans lesquelles les documents de marché (ou des parties de ceux-ci) sont officieusement disponibles: anglais

Date limite de demande d'informations complémentaires: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Adresse des documents de marché: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: anglais

Catalogue électronique: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée

Date limite de réception des offres: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Durée de validité des offres: 180 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Lieu: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Pas encore connu

Facturation électronique: Requise

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: The High Court of Ireland

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Education Procurement Service (EPS)

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: The High Court of Ireland

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Education Procurement Service (EPS)

Organisation qui traite les offres: Education Procurement Service (EPS)

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Education Procurement Service (EPS)

Numéro d'enregistrement: IE 6609370 G

Adresse postale: Castletroy Limerick

Ville: Limerick

Code postal: V94 DK53

Subdivision pays (NUTS): Mid-West (IE051)

Pays: Irlande

Adresse électronique: info@educationprocurementservice.ie

Téléphone: 000

Adresse internet: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Profil de l'acheteur: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures

Organisation qui traite les offres

8.1. ORG-0002

Nom officiel: The High Court of Ireland

Numéro d'enregistrement: The High Court of Ireland

Département: The High Court of Ireland

Adresse postale: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Ville: Dublin

Code postal: D07 WDX8

Subdivision pays (NUTS): Dublin (IE061)

Pays: Irlande

Adresse électronique: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Téléphone: +353 1 8886000

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1. ORG-0003

Nom officiel: European Dynamics S.A.

Numéro d'enregistrement: 002024901000

Département: European Dynamics S.A.

Ville: Athens

Code postal: 15125
Subdivision pays (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Pays: Grèce
Adresse électronique: eproc-esender@eurodyn.com
Téléphone: +30 2108094500
Rôles de cette organisation:
TED eSender

10. Changement

Version de l'avis antérieur à modifier
:
46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01
Principale raison du changement
:
Mise à jour d'informations

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d'avis: 16
Date d'envoi de l'avis: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: anglais
Numéro de publication de l'avis: 488696-2026
Numéro de publication au JO S: 134/2026
Date de publication: 15/07/2026